

高致密金属膜&低温氮/碳化合物膜真空镀膜

产品名称	高致密金属膜&低温氮/碳化合物膜真空镀膜
公司名称	安徽纯源镀膜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:纯源镀膜 产地:安徽合肥 是否来料定制:是
公司地址	合肥市高新区大别山路1599号
联系电话	0551-63652293 18356509334

产品详情

金属膜层可以改善材料的性能，薄的金属膜可以改变电学和装饰性能，提高材料的磨损抗力、化学抗力、硬度和化学性能。

金属Cr层具有硬度高、耐磨、反光性能好、化学稳定性好等特点。

通过真空离子镀膜制备的金属膜层相比蒸镀、溅镀具有如下几个优点：

- 1.附着力好，膜层不易脱落；
- 2.绕射性能好，可以将待镀物品所有表面均匀镀上薄膜；
- 3.膜层质量高，组织致密

金属Cr层具有硬度高、耐磨、反光性能好、化学稳定性好等特点。

金属Ti层具有高的热强性、持久强度、良好耐腐蚀性、亲生物性、抗阻尼性能，无磁无毒。

金属Cu层具有延展性、导热性、导电性高、电阻率低等特点。

金属Ni层具有较高的硬度、耐腐蚀性高、磁性、装饰性。

金属Ag层具有极好导电性、导热性、装饰性、反光性、提高材料焊接性能。

金属Al层具有极好的反光性、导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、抗磁化性、阻燃性、装饰性，且毒

副作用小。

氧化物膜层：

SiO₂涂层具有无毒、热稳定性好、机械稳定性好和结构易于调整等优点。疏油疏水，甚至可以抵抗一些有机溶剂。

Al₂O₃是铝的稳定氧化物，Al₂O₃薄膜是一种常用的功能薄膜材料，由于具有高的透射比、高化学稳定性、高绝缘性、良好的耐高温耐腐蚀等优良的物理化学性质。

Cr₂O₃具有高化学稳定性、耐腐蚀、极好的亲水性。

TiO₂有高折射率、高介电常数、良好的半导体性能和化学稳定性还具有良好的血液相容性。

ZrO₂有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数等特性。

氮化物膜层：

CrN具有优异耐磨性、抗氧化、抗腐蚀性、高光洁度、低化学亲和力、提高产品脱模性能

TiN具有硬度高、摩擦系数低、良好化学惰性良好的生物相容性、提升材料抗磨性等特性。

TiAlN涂层一般称之为“中铝”，它拥有好的耐高温，耐腐蚀，高硬度，且摩擦系数较低。

AlTiN涂层一般称之为“高铝”，拥有优异的耐高温，耐腐蚀，高硬度。

TiSiN涂层为TiN和Si₃N₄的纳米晶复合结构，具有极高的抗热性能，独特的外观，超长的服役寿命，兼具高韧性和高硬度。

CrAlN拥有良好的抗冲击、防腐蚀性、耐磨性、耐高温性能。

应用领域：合金及不锈钢加工刀具、硬质合金及高速钢滚齿刀、各类冲压、挤压、注塑模具及其他涉及耐磨、耐冲击、耐腐蚀领域，适合用于干式切削。